

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 1 日 (01.09.2005)

PCT

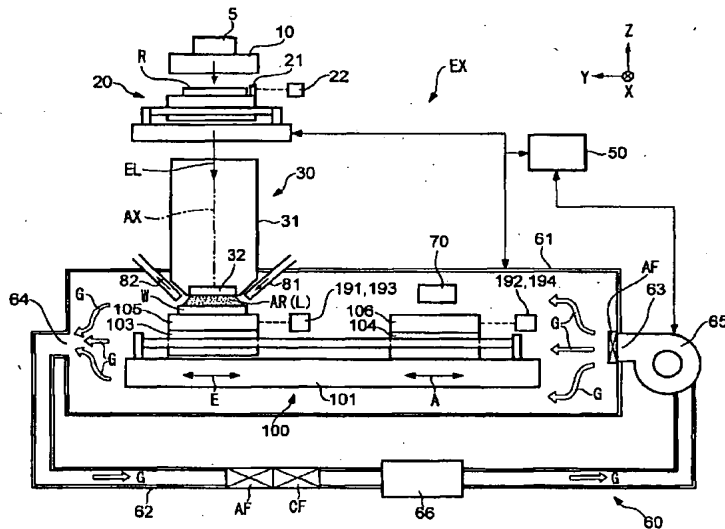
(10) 国際公開番号
WO 2005/081291 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01L 21/027, G03F 7/20 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002444 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高岩 宏明
(22) 国際出願日: 2005 年 2 月 17 日 (17.02.2005) (TAKAIWA, Hiroaki) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 志賀 正武, 外 (SHIGA, Masatake et al.); 〒
(26) 国際公開の言語: 日本語 1048453 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 Tokyo
(30) 優先権データ: (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
特願2004-043114 2004 年 2 月 19 日 (19.02.2004) JP 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008331 DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 Tokyo (JP). ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,

[続葉有]

(54) Title: EXPOSURE APPARATUS AND METHOD OF PRODUCING DEVICE

(54) 発明の名称: 露光装置及びデバイスの製造方法



(57) Abstract: An exposure apparatus (EX) has an exposure region (E) for irradiating exposure light (EL) to a substrate (W) through an optical system (30) and liquid (LQ) and has a measurement region (A) for acquiring information on the position of the substrate (W) prior to the exposure. The substrate (W) is exposed when moved between the exposure region (E) and the measurement region (A). The exposure apparatus (EX) has an entry shutoff mechanism (60) for preventing a gas (G) in the vicinity of the exposure region (E) from entering into the measurement region (A).

(57) 要約: 光学系 (30) と液体 (LQ) とを介して基板 (W) に露光光 (EL) を照射する露光領域 (E) と、露光に先立って基板 (W) の位置に関する情報を取得する計測領域 (A) と、を有し、露光領域 (E) と計測領域 (A)

[続葉有]



NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

)との間で基板(W)を移動させて、基板(W)の露光を行う露光装置(EX)において、露光領域(E)の周辺の気体(G)が計測領域(A)に侵入することを防止する侵入遮断機構(60)を備える。